

灰化装置マニュアル (2017/03/31)

<注意事項>

注 1. 続けて使用する場合は温度に注意。温度が高いままアッシング・デスカムを行うとレートが高くなる。

注 2. 流量計の ON/OFF 時は流量計（ニードルバルブ）を閉める。怠るとガスがいききに流れて流量計が壊れる。

注 3. 流量計を閉める際は軽く。ニードルバルブは壊れやすいので指でつまんで回す程度の力加減。

<マニュアル>

1. 主電源 (Main スイッチ) ON

2. Power ON

3. 試料台と試料のセット。

蓋を開けると N2 が流れっぱなしなので、試料セットは素早く行う

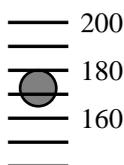
- ・ デスカム トンネルあり、試料台横方向使用
- ・ アッシング トンネルなし、試料台縦方向使用

(標準条件を裏面に記載)

4. (注 1) Pump ON で真空引き開始 (5min.以上, 3Pa 程度まで)

5. 出力設定

- ・ 50W → 目盛り : 1.08
- ・ 100W → 目盛り : 1.95
- ・ 200W → 目盛り : 3.85
- ・ 300W → 目盛り : 6.03



流量計設定例 : 180 sccm

6. Gas 2 ON (注 2)

7. O₂ ニードルバルブ開
(ゆっくり)

8. 流量設定

9. 圧力が安定するまで待つ、Timer の時間設定

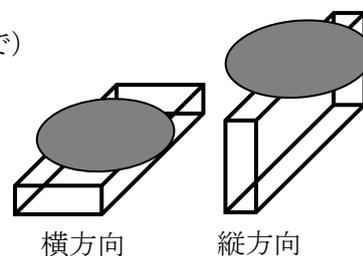
10. Output ON で灰化開始、同時に Timer ON (反射が多いときは、一瞬だけ出力を上げるとよい)

11. 灰化終了後 Output ボタン Off (プラズマ出力は停止しているがボタンは ON になっている)

12. Timer Off

13. 流量計閉 (注 3)

14. 流量計 Off (注 2)



※ 基板が落ち易いので注意

15. Pump スイッチ Off でリーク開始
16. 試料取り出し
- # 引き続き行う場合は 4.へ戻る
17. Power Off、主電源 (Main スイッチ) Off

- # 灰化装置の蓋をきちんとしておくこと
- # 使用記録を書いておくこと
- # エッチトンネルはデシケータへ戻すこと

<標準条件>

- 現像後残渣処理 LOR 未使用時
 デスカム(with etch-tunnel), 50W, 180 sccm, 10min.
- 現像後残渣処理 LOR 使用時
 デスカム(with etch-tunnel), 100W, 180 sccm, 20min.
- リフトオフ後残渣処理
 アッシング(w/o etch-tunnel), 200W, 180sccm, 10min.

